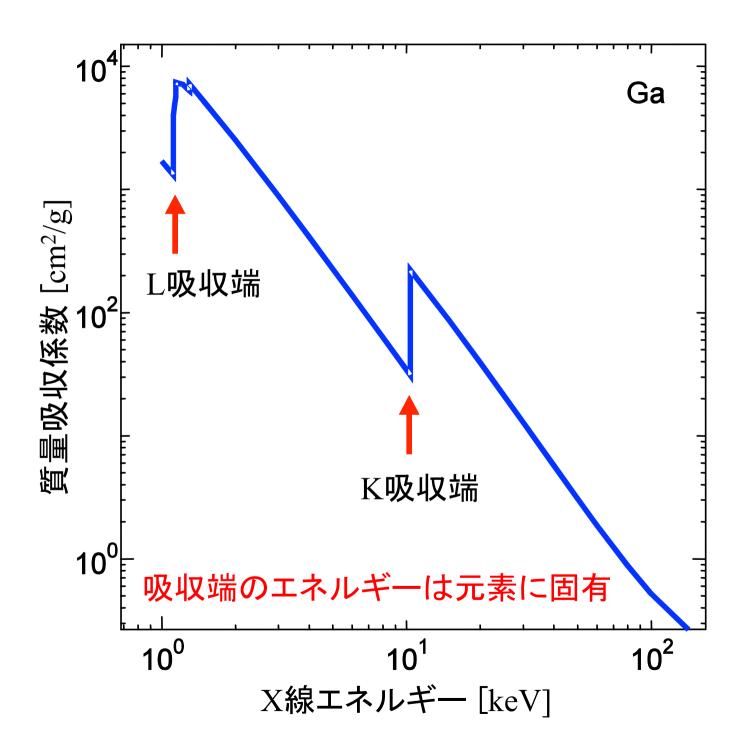
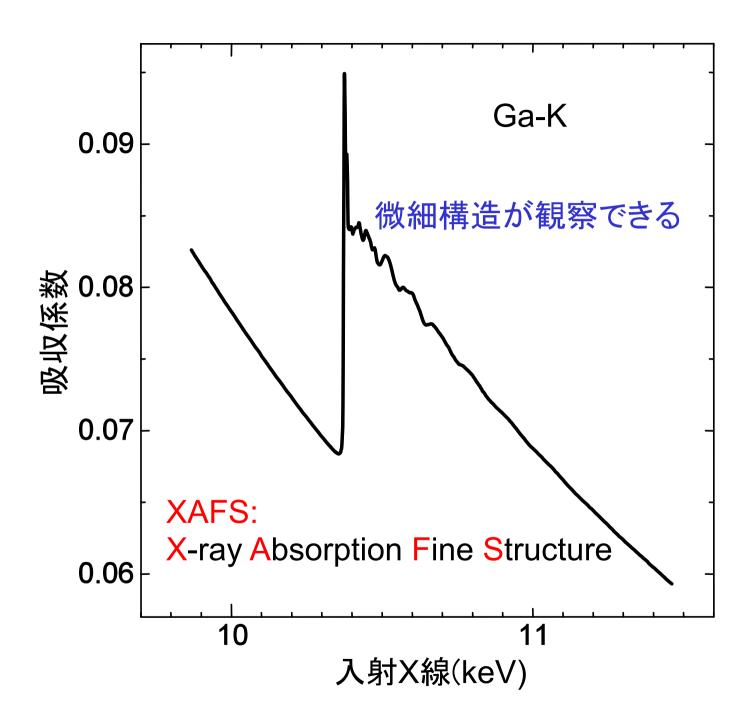
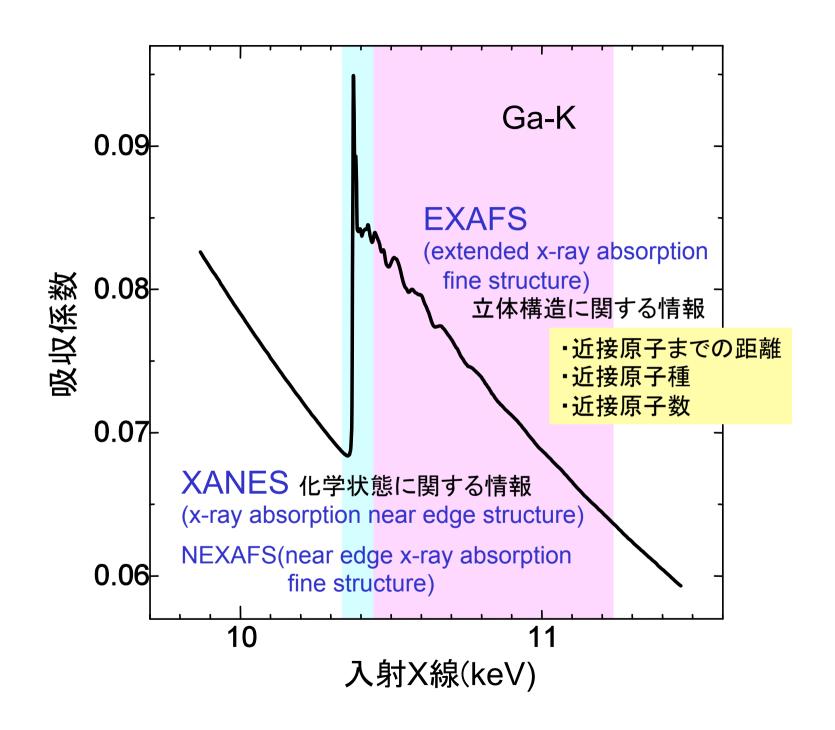
平成26年6月2日(月) シンクロトロン光利用者研究会 平成26年度 第3回XAFSグループ

# XAFS概論

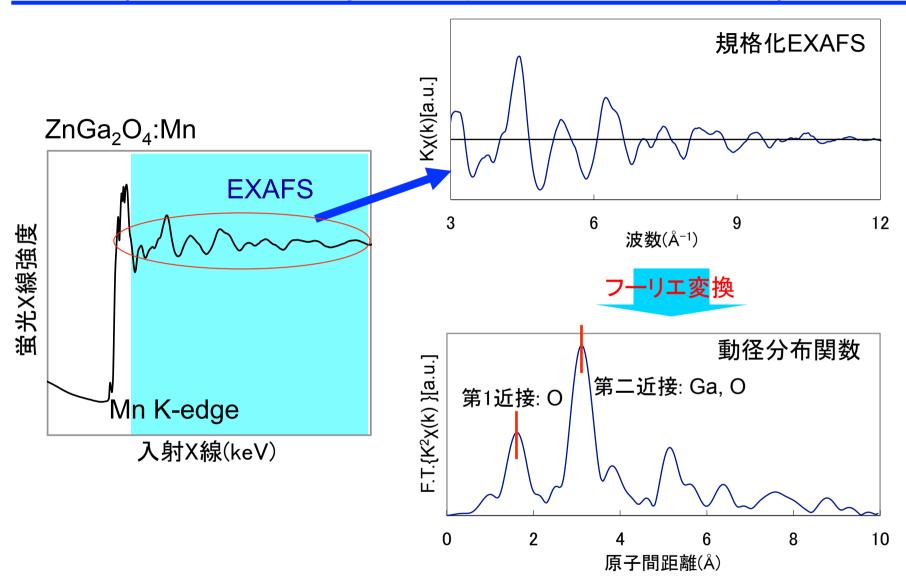
名古屋大学シンクロトロン光研究センター 田渕雅夫



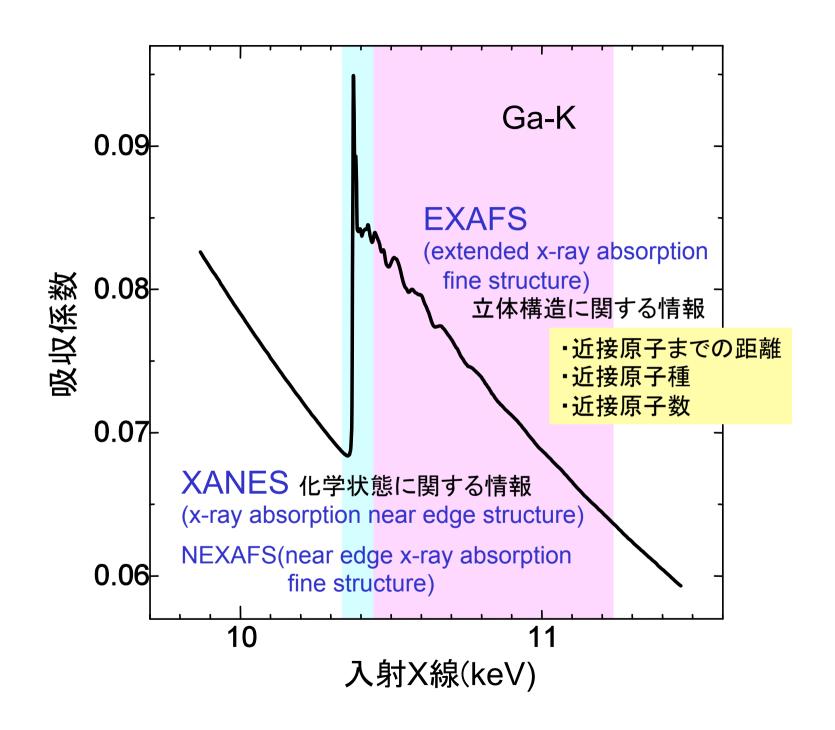


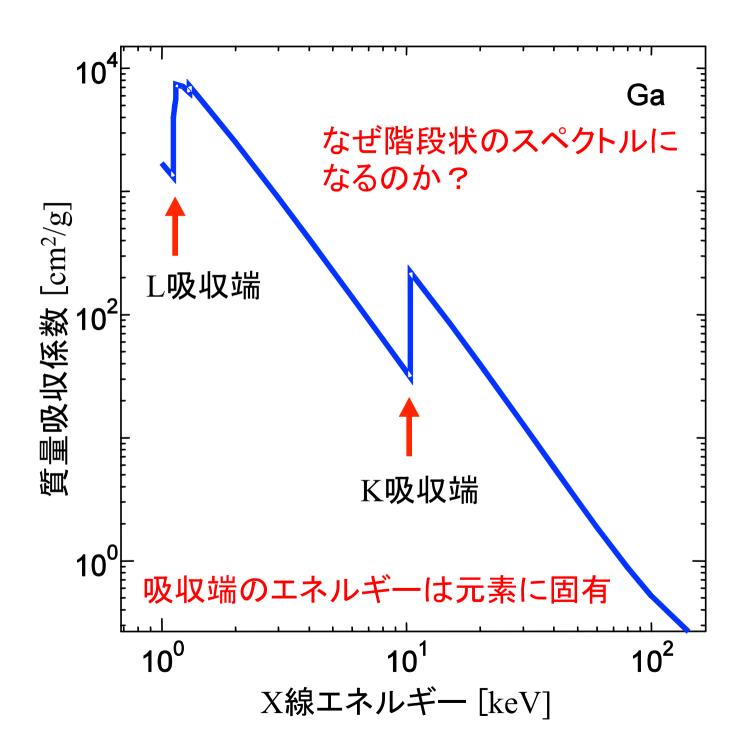


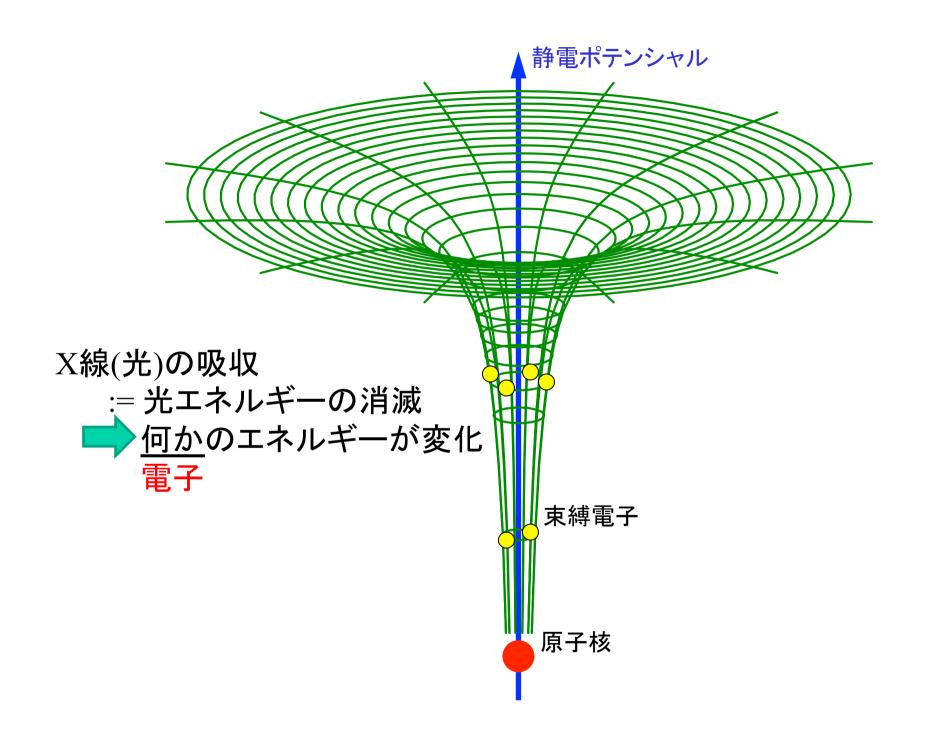
#### **EXAFS(Extended X-ray Absorption Fine Structure)**

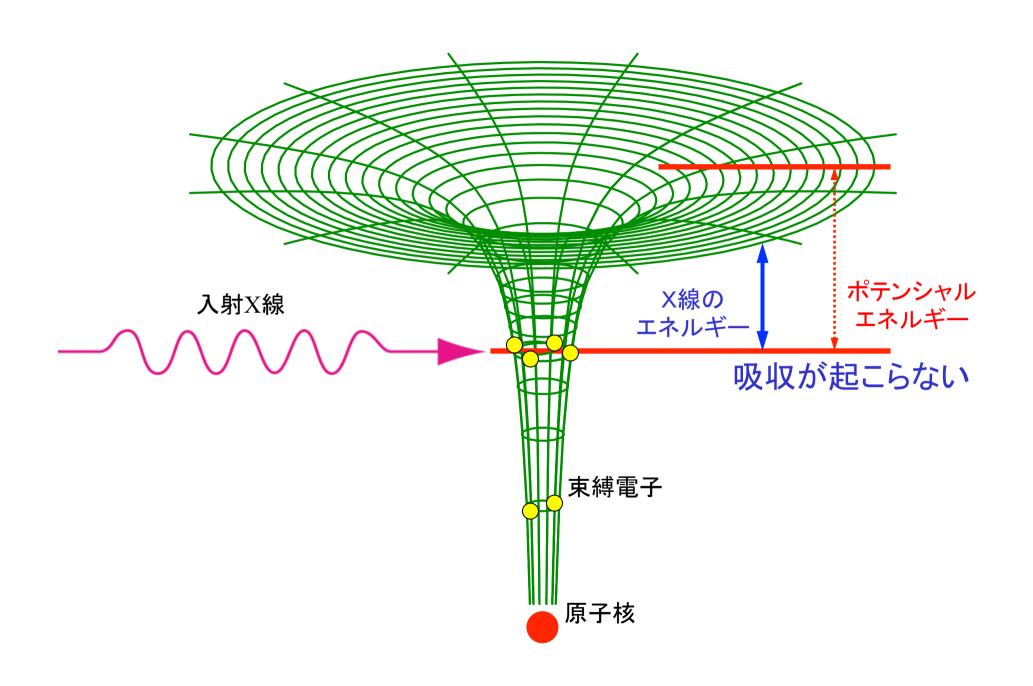


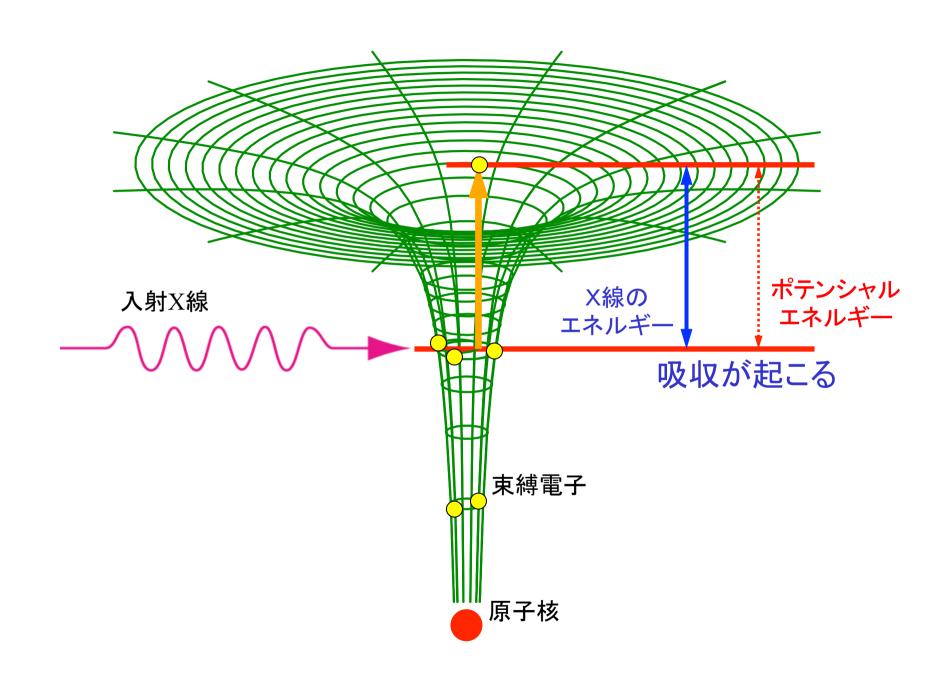
特定原子種の局所構造(配位子の種類、数、距離)がわかる。

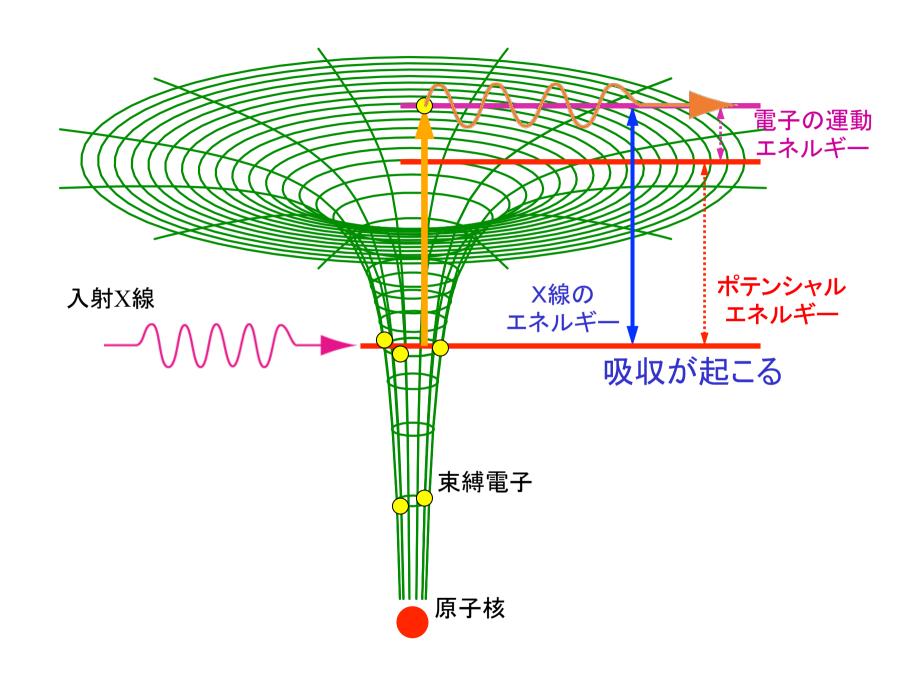


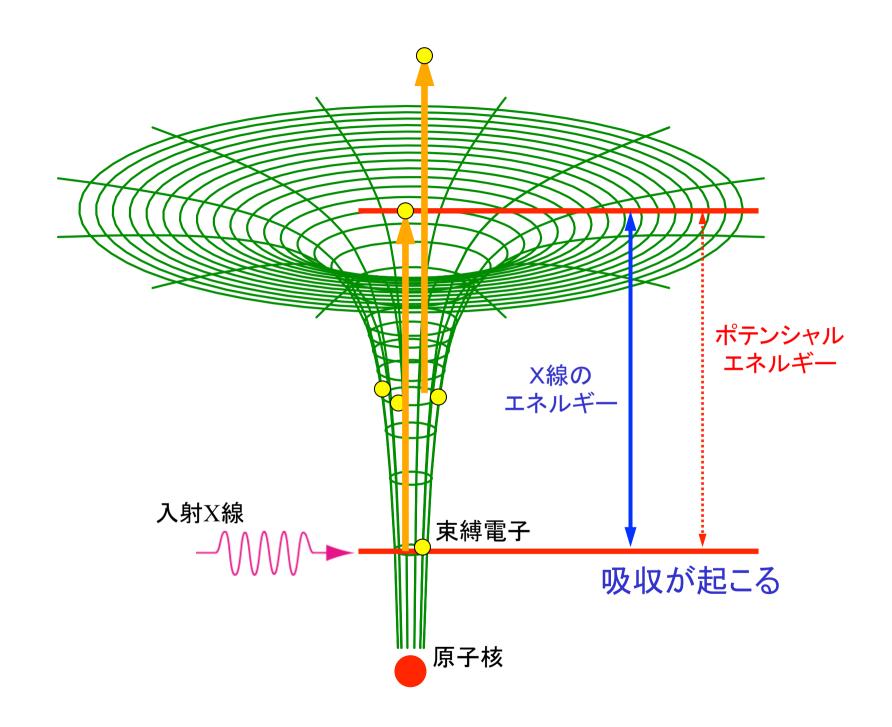


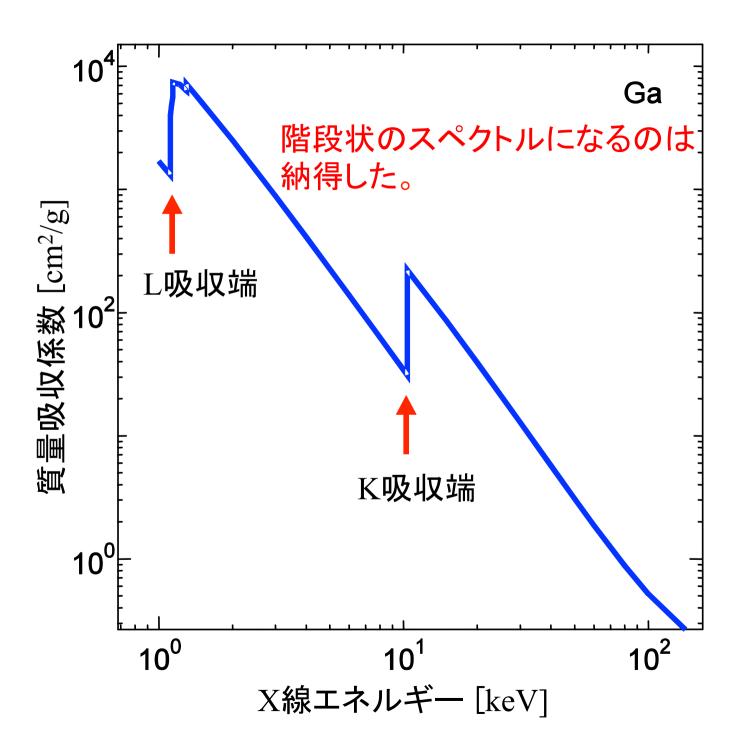


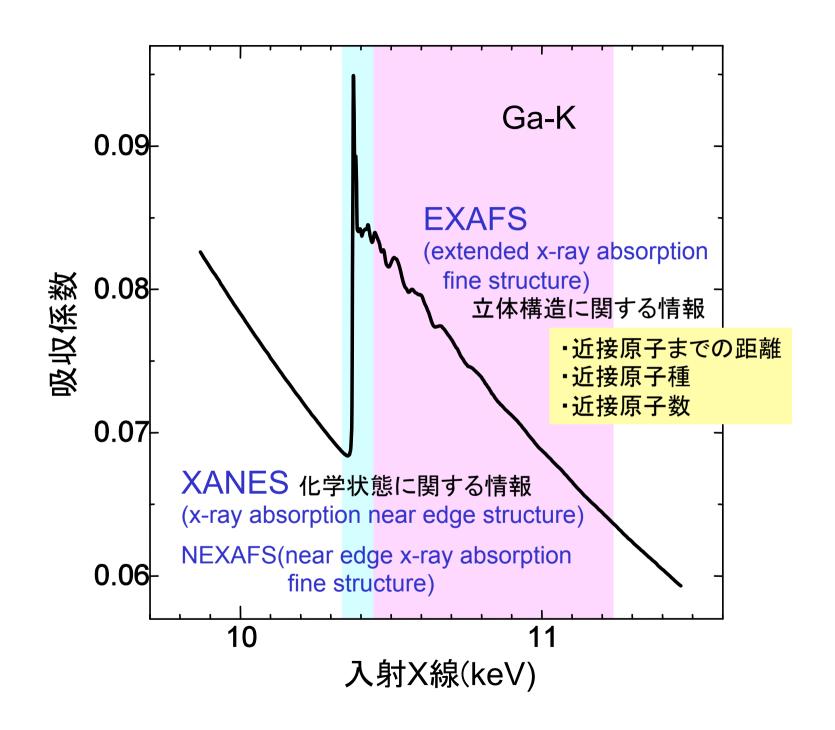


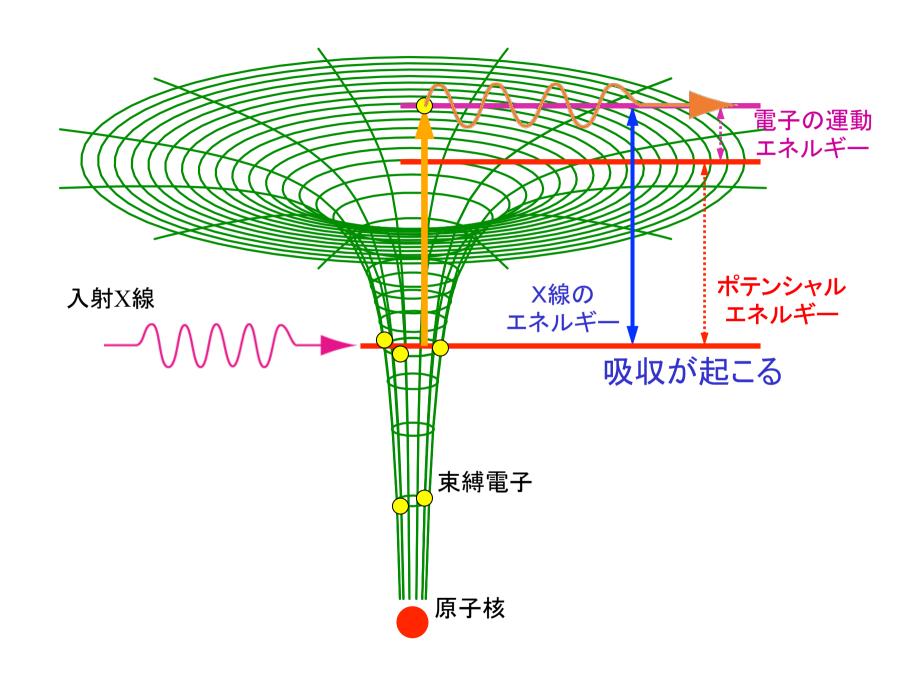










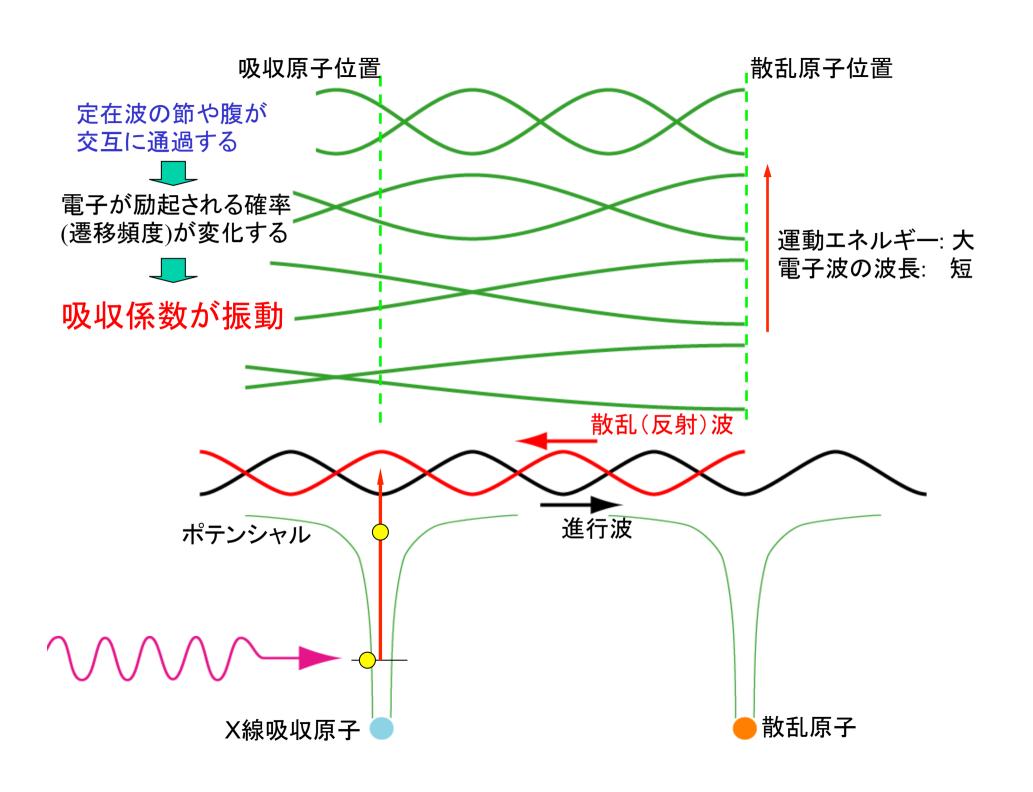


近傍の原子が 電子波を散乱する

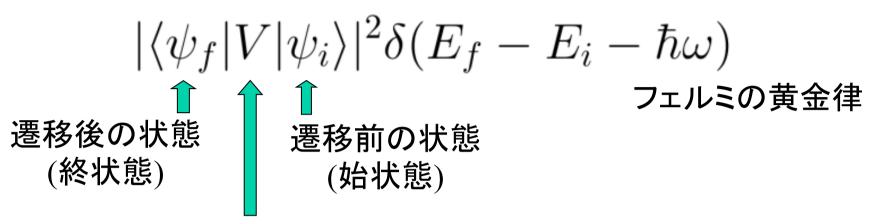




X線を吸収した原子 (電子波の発生源)



#### 電子の遷移確率(遷移頻度)



遷移の原因になる外乱  $V: {m A}\cdot {m p}$ 

 $m{A}$ :電磁波を表すベクトルポテンシャル  $m{A} \propto m{E}$ 

$$m{p}$$
:電子の運動量演算子  $m{p}=(rac{\partial}{\partial x},rac{\partial}{\partial y},rac{\partial}{\partial z})$ 

さらに変形して

$$V: m{A} \cdot m{p} \propto \hat{e} \cdot m{r}$$
 例えば  $\hat{e} = (1,0,0)$  なら

光の偏光方向の単位ベクトル。  $V: \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} \propto \hat{e} \cdot \mathbf{r} = x$ 

双極子近似による吸収係数

$$\mu \propto \sum_{f} |\langle \psi_{f} | \hat{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{r} | \psi_{i} \rangle|^{2} \delta(E_{f} - E_{i} - \hbar \omega)$$

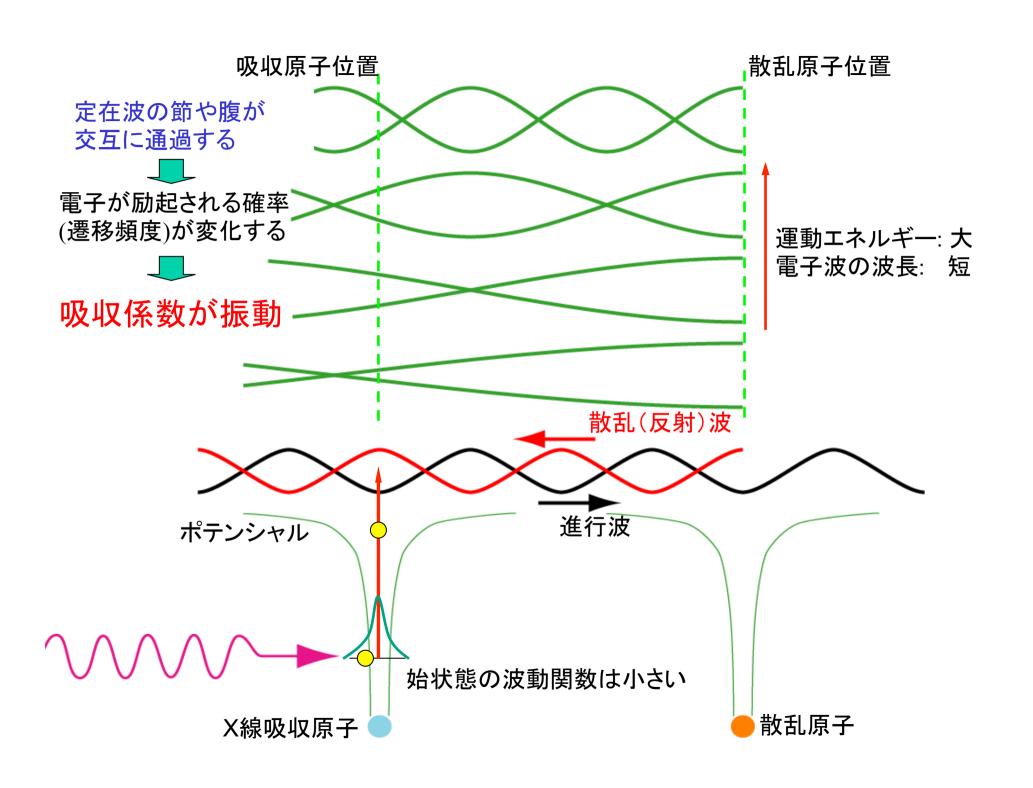
$$\langle \psi_{f} | \hat{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{r} | \psi_{i} \rangle = \int \psi_{f}^{*} \hat{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{r} \psi_{i} d\boldsymbol{r}$$

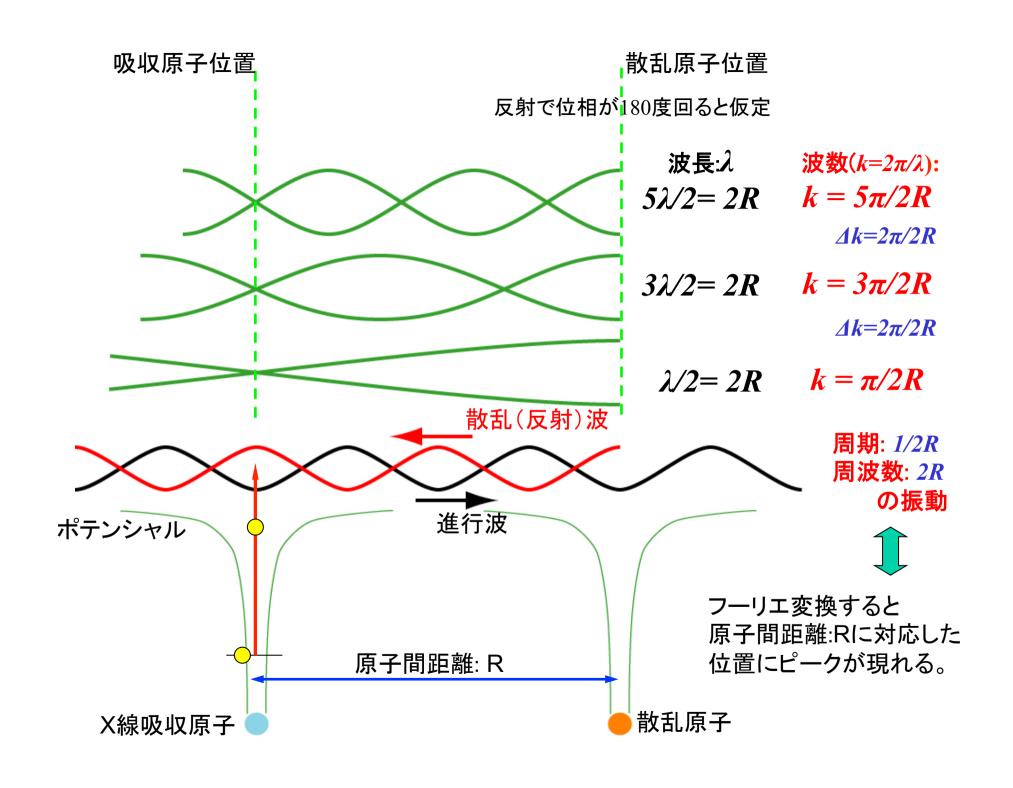
「終」状態の波動関数

「始」状態の波動関数

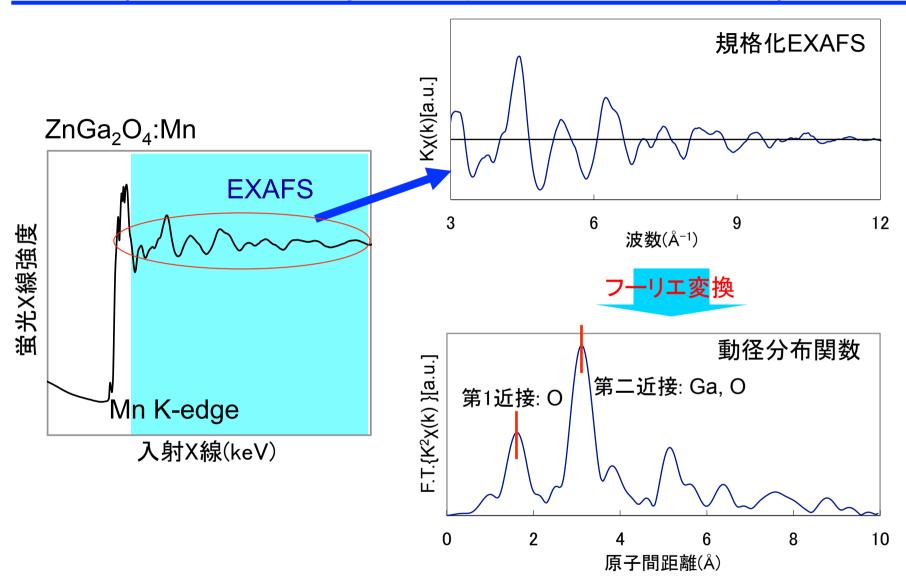
「始」状態が原子に束縛された状態なら、

- 1) その波動関数は小さな範囲でだけ値を持つので、 終状態の波動関数の吸収原子の位置での大きさが重要 「始」状態が S 軌道、外乱部分が x (直線偏向の光) なら、
  - 2)「終」状態の平面波はx方向に進行する。
  - 3)「終」状態が、x 方向の奇関数の時、吸収が大きくなる 偶関数の時、小さくなる。



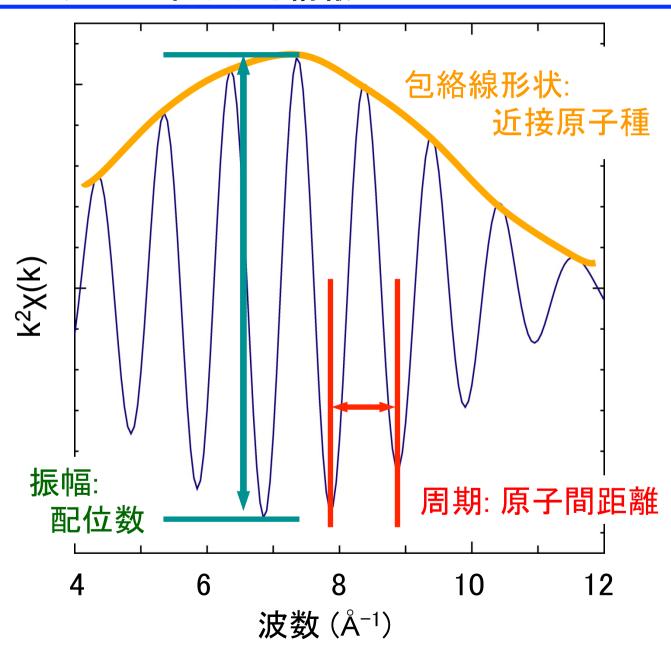


#### **EXAFS(Extended X-ray Absorption Fine Structure)**

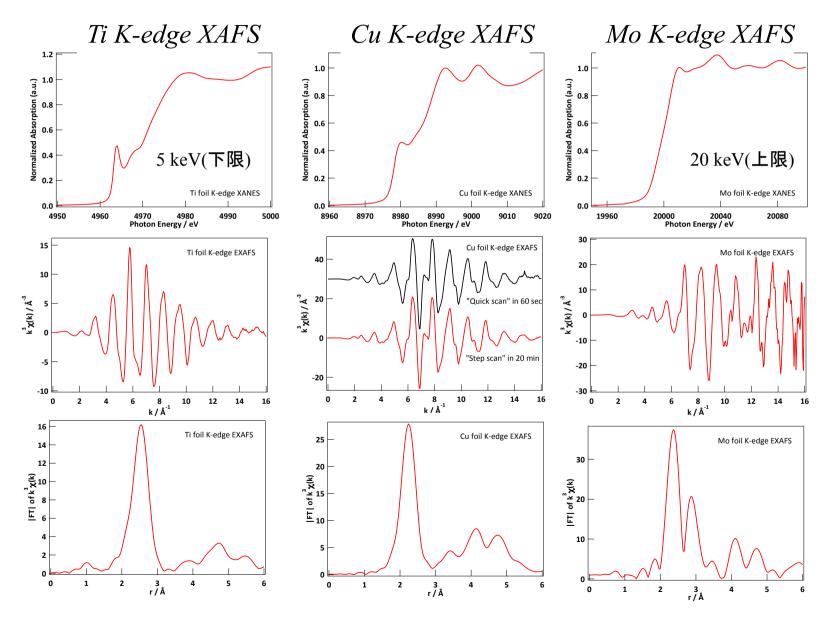


特定原子種の局所構造(配位子の種類、数、距離)がわかる。

### EXAFSスペクトルに含まれる情報



## 典型的な金属箔のスペクトル



#### EXAFSスペクトルに含まれる情報



振幅: 配位数 近接原子種

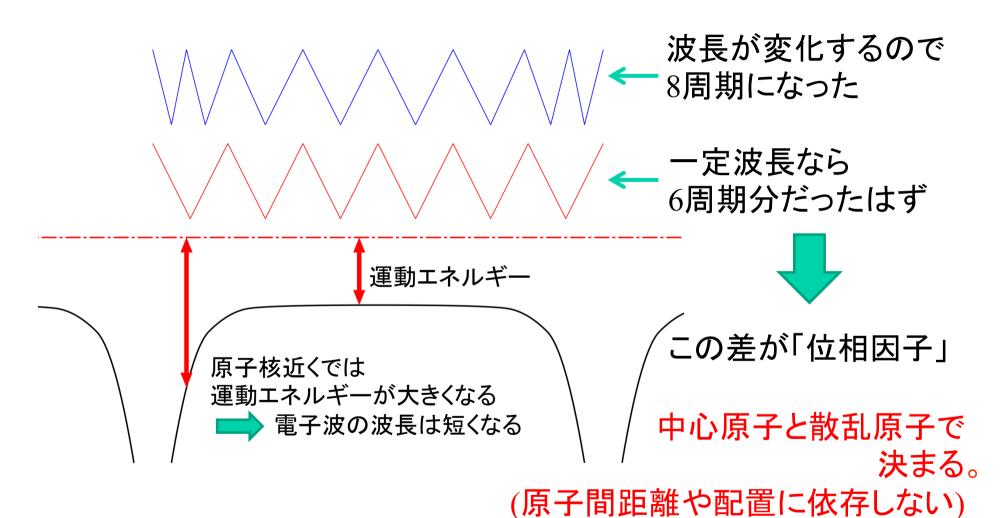
周期: 原子間距離

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k, \pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

べ位相因子: 電子波の波長が 場所によって変わる分を補正

デバイワラ因子:動的(熱的)、静的な構造の乱れによる減衰

平均自由行程: 電子の到達 可能範囲に対応



(反射することそのものによる位相変化もあるが、これも原子が決まると決まる。)

#### EXAFSスペクトルに含まれる情報



振幅: 配位数 近接原子種

周期: 原子間距離

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k, \pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

べ位相因子: 電子波の波長が 場所によって変わる分を補正

デバイワラ因子:動的(熱的)、静的な構造の乱れによる減衰

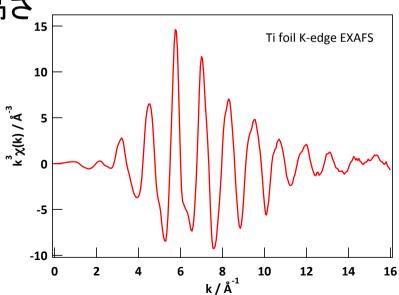
平均自由行程: 電子の到達 可能範囲に対応

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k,\pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

XAFSの式に含まれる未知量  $S_0$ 、N、f、R、 $\Phi$ 、 $\sigma$ 、 $\lambda$ 

1回の測定であらわにわかる独立の量は3つ。

- a) 振幅
- b) 振動のピークの位置
- c) 振動の個々のピークの高さ



$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k, \pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

XAFSの式に含まれる未知量  $S_0$ 、N、f、R、 $\Phi$ 、 $\sigma$ 、 $\lambda$ 

- 1回の測定であらわにわかる独立の量は3つ。
  - a) 振幅

$$S_0$$
,  $N$ ,  $(R)$ 

- b) 振動のピークの位置 R、 $\Phi$
- c) 振動の個々のピークの高さ  $f, \sigma, \lambda, (R)$

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k,\pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

XAFSの式に含まれる未知量  $S_0$ 、N、f、R、 $\Phi$ 、 $\sigma$ 、 $\lambda$ 

「標準」試料(N、R: 既知、 $\sigma$ 、 $\lambda$ : 適当に仮定)を測定。

a) 振幅

$$S_0$$
,  $N$ ,  $(R)$ 

- b) 振動のピークの位置 R、 $\Phi$
- c) 振動の個々のピークの高さ  $f, \sigma, \lambda, (R)$
- $\rightarrow S_0$ 、 $\Phi$ 、f が決まる。

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k,\pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

XAFSの式に含まれる未知量  $S_0$ 、N、f、R、 $\Phi$ 、 $\sigma$ 、 $\lambda$ 

「未知」試料(N、R: 未知、 $\sigma$ 、 $\lambda$ : 適当に仮定)を測定。 ( $S_0$ 、 $\Phi$ 、fは「標準」試料で決定済み)

a) 振幅

$$S_0$$
,  $N$ ,  $(R)$ 

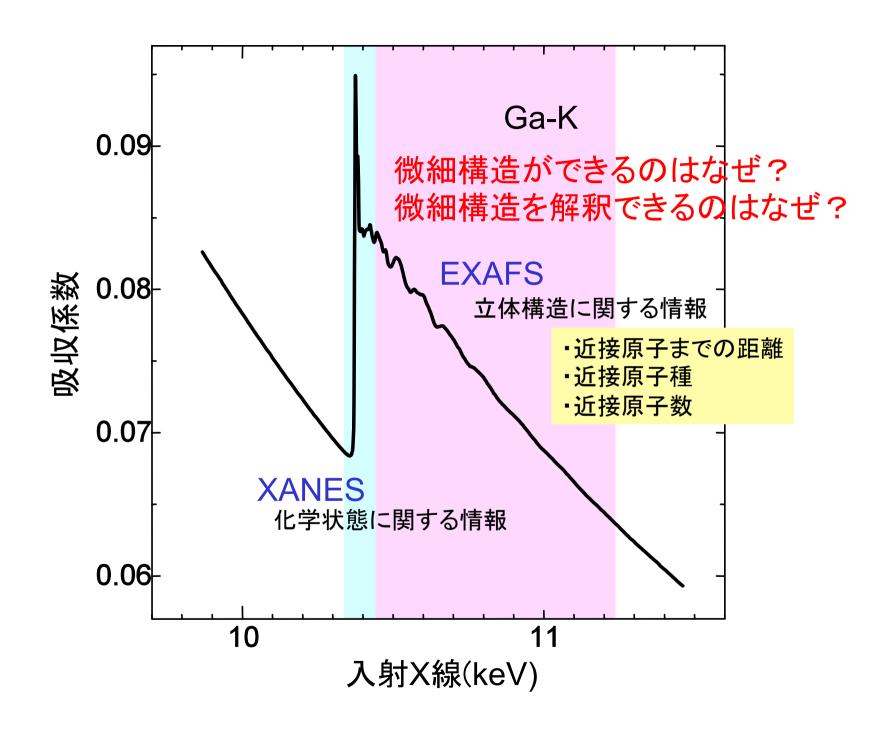
- b) 振動のピークの位置 *R*、**Φ**
- c) 振動の個々のピークの高さ f、 $\sigma$ 、 $\lambda$ 、(R)
- $\rightarrow N$ 、R、f(原子種、組成)が決まる。

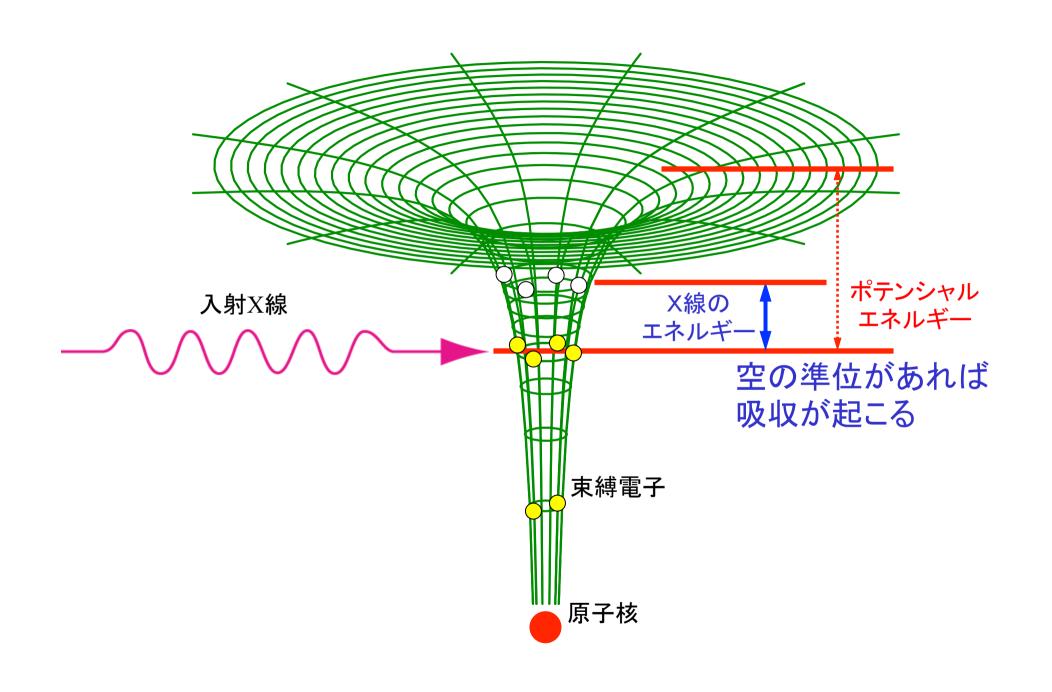
$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k,\pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

(In<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>)As のAs 周りの構造を知りたい。

- 1) 標準試料として GaAs, InAs を準備し、測定する。
- 2) N(=4), R(As-Ga=2.45、As-In=2.62) は既知。  $\sigma$ (=0.05)は仮定。 $\lambda$ (=0)は無視。
  - $\rightarrow$  未知だった  $S_0$ ,  $f_{\text{As-In}}$ ,  $f_{\text{As-Ga}}$ ,  $\Phi_{\text{As-In}}$ ,  $\Phi_{\text{As-Ga}}$  が決まる。
- 3) 構造未知の InGaAs を測定する。

 $S_0$ ,  $f_{As-In}$ ,  $f_{As-Ga}$ ,  $\Phi_{As-In}$ ,  $\Phi_{As-Ga}$  が分かっているので、  $\chi(k) = x \chi_{As-In}(k) + (1-x) \chi_{As-Ga}(k)$  と考えてフィッティングすると  $\rightarrow x$ ,  $N_{In}$ ,  $N_{Ga}$ ,  $R_{As-In}$ ,  $R_{As-Ga}$  が決まる。





双極子近似による吸収係数

$$\mu \propto \sum_{f} |\langle \psi_{f} | \hat{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{r} | \psi_{i} \rangle|^{2} \delta(E_{f} - E_{i} - \hbar \omega)$$

$$\langle \psi_{f} | \hat{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{r} | \psi_{i} \rangle = \int \psi_{f}^{*} \hat{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{r} \psi_{i} d\boldsymbol{r}$$

「終」状態の波動関数

「始」状態の波動関数

「始」状態が原子に束縛された状態なら、

- 1) その波動関数は小さな範囲でだけ値を持つので、 終状態の波動関数の吸収原子の位置での大きさが重要 「始」状態が S 軌道、外乱部分が x (直線偏向の光) なら、
  - 2)「終」状態の平面波はx方向に進行する。
  - 3)「終」状態が、x 方向の奇関数の時、吸収が大きくなる 偶関数の時、小さくなる。

#### XAFS Study of Ti-Silicalite: Structure of Framework Ti(IV) in the Presence and Absence of Reactive Molecules (H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>) and Comparison with Ultraviolet-Visible and IR Results

#### S. Bordiga, S. Coluccia, C. Lamberti, L. Marchese, and A. Zecchina

Dipartimento di Chimica Inorganica, Chimica, Fisica e Chimica dei Materiali. Via P. Giuria 7, I-10125 Torino, Italy

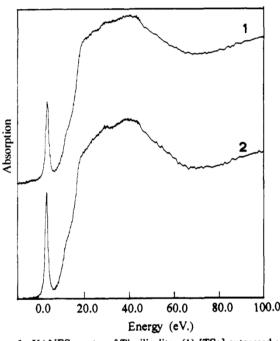


Figure 1. XANES spectra of Ti-silicalite: (1) [TSa] outgassed at 300 K; (2) [TSa] outgassed at 400 K. (The zero of the energy scale was taken at 4964.2 eV, which corresponds to the maximum of the first peak of a titanium foil K edge.)

100.0

Figure 2. Silicalite framework where [TiO<sub>4</sub>] is substituting for a [SiO<sub>4</sub>] building unit. Inset a: [TiO<sub>4</sub>] unit surrounded by four [SiO<sub>4</sub>] units (the Ti(IV) center is represented by a black ball). Inset b: after water hydrolysis of a Ti-O-Si bridge shown in a inset a (black balls indicate Ti(IV) and hydroxyl groups).

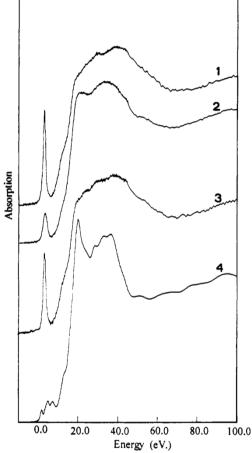
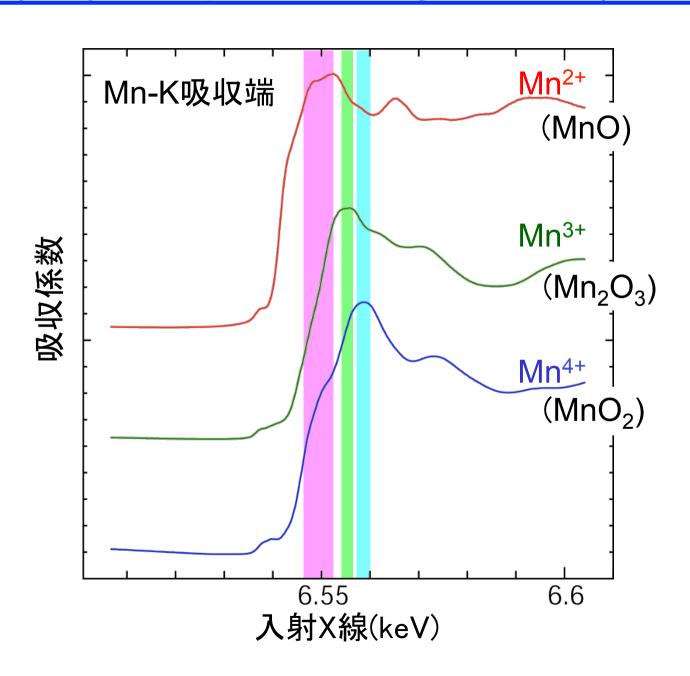


Figure 4. XANES spectra of [TSa] outgassed at 400 K, the effect of NH<sub>3</sub> adsorption and desorption: (1) [TSa] in vacuo; (2) after dosage of NH<sub>3</sub> (equilibrium pressure of 10<sup>4</sup> Pa); (3) effect of pumping at room temperature for 10 min (energy scale as in Figure 1); (4) TiO<sub>2</sub> (anatase).

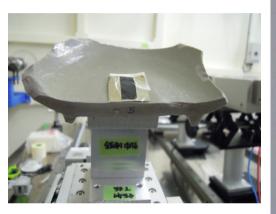
Tiはシリケートの骨格に入り4配位となる。 その構造は吸湿・脱水で可逆的に変化する。 アンモニアとの反応で可逆的にアナターゼに近い構造を作る。

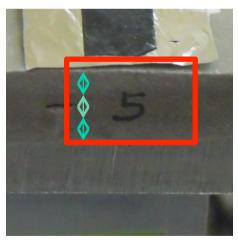
### XANES(X-ray Absorption Near Edge Structure)の例

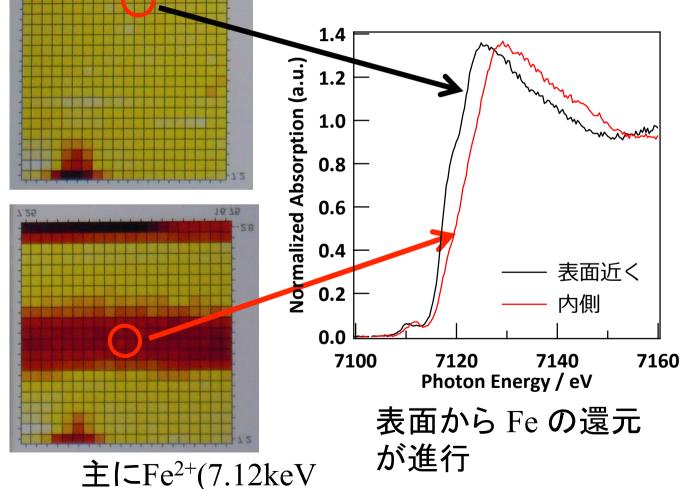


## 陶磁器に含まれる鉄

価数遅<u>ローカーフッピング</u> 全Fe(8keV励起)







#### EXAFS測定に必要なX線

#### EXAFS測定: X線領域の吸収測定

- ・広いエネルギー範囲(500~1000eV)を をスキャンする必要がある。
- 一つのスペクトルには数百の測定点が 含まれる。



光源として、放射光が不可欠

